


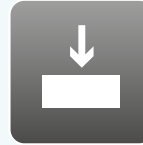

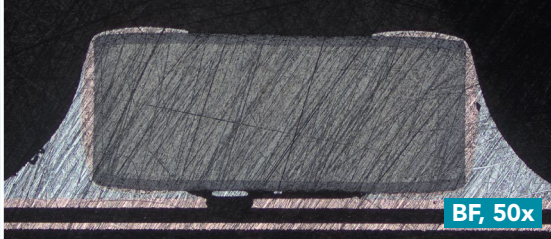
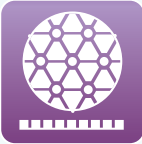


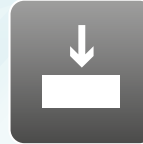





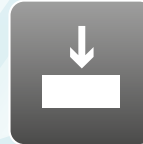

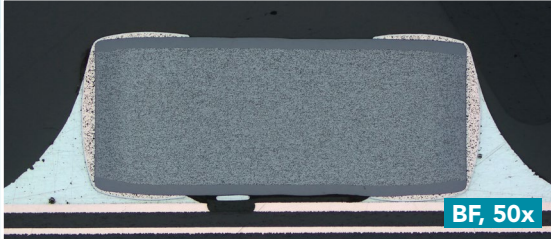





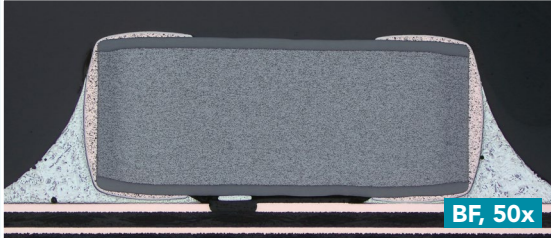


Aka-Brief #2 陶瓷电容器 (MLCC)

1							
	Rhaco Grit P800	水	300 RPM	25 N	磨平		BF, 50x
2							
	Largan 9	DiaUltra 6 µm	150 RPM	30 N	3 min		BF, 50x
3							
	Daran	DiaUltra 1 µm	150 RPM	25 N	3 min		BF, 50x
4							
	Chemal*	Colloidal Silica 50 nm Alkaline	150 RPM	15 N	2 min		BF, 50x

图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

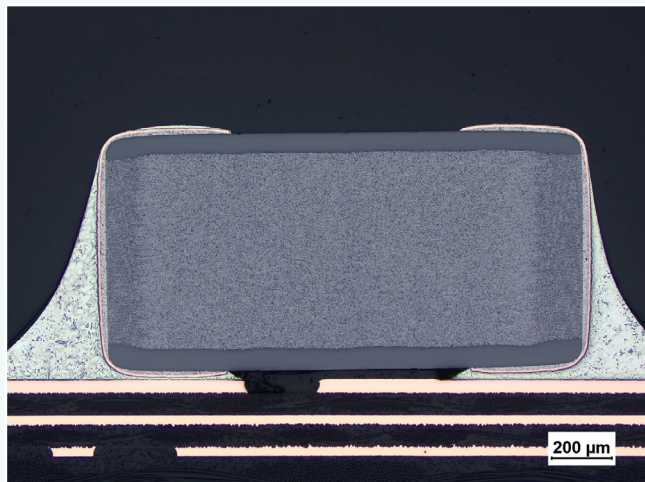
样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

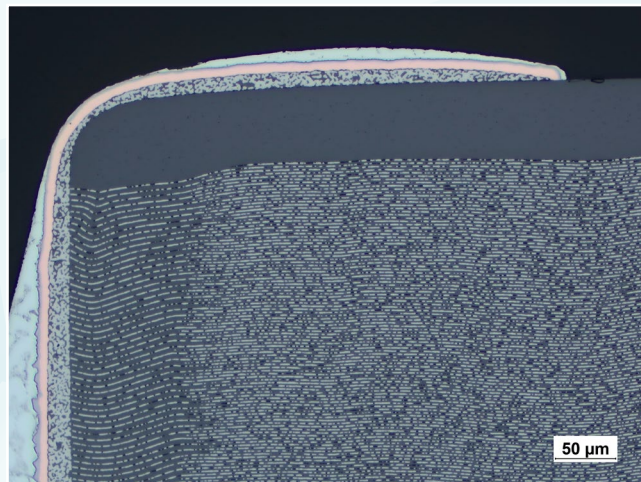
*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

Aka-Brief #2 陶瓷电容器 (MLCC)

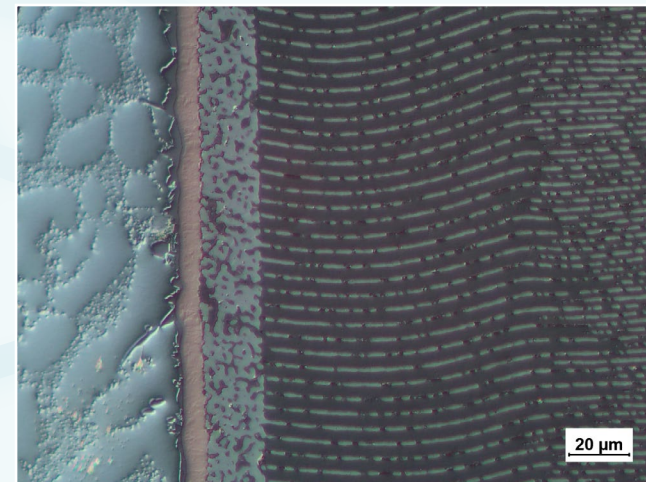
最终制样结果



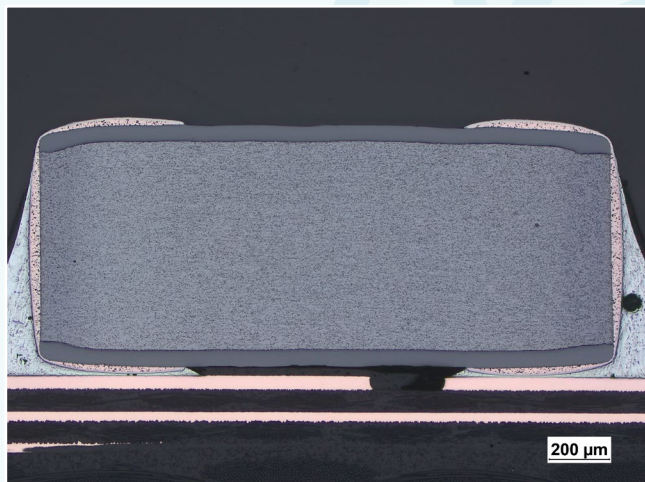
MLCC, 样品1, 明场像, 50倍



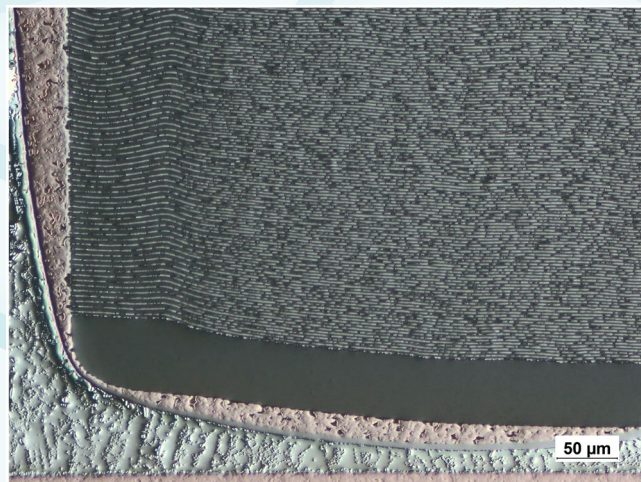
MLCC, 样品1, 明场像, 200倍



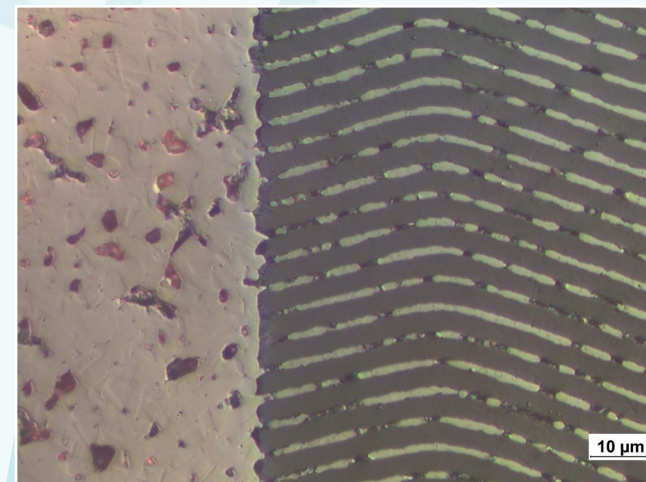
MLCC, 样品1, 微分干涉衬度像, 500倍



MLCC, 样品2, 明场像, 50倍



MLCC, 样品2, 微分干涉衬度像, 200倍



MLCC, 样品2, 微分干涉衬度像, 1000倍